

# イオン注入装置チーム

<氏名> 大平 俊行

<役職> チームリーダー

<所属> 産業技術総合研究所

## <開発内容>

ミニマルファブ生産システムに導入可能な小型で低価格のイオン注入装置の開発を行います。

## <自己紹介>

京都大学で博士課程までイオン加速器を用いてイオンビームと固体、表面の相互作用の基礎研究を行い、1994年電子技術総合研究所（2001 から産総研）入所。入所後は低速陽電子ビームを用いた固体最表面分析法の開発、LSI 材料等の空孔欠陥分析装置の開発、装置製品化などを行ってきた。現在、産総研計測フロンティア研究部門 極微欠陥評価研究グループ 主任研究員。

<氏名> 北村 是尊

<役職> サブリーダー

<所属> フジ・インバック株式会社

## <開発内容>

ウエハプロセスの一つであるイオン注入装置開発を担当しています。

高電圧、高真空を利用する装置であるが故にウエハプロセス装置の中でも大型化してきたものをミニマルファブ装置として完成させるよう努めて参ります。構造を簡略化し、シンプルな機構の中で効率の良いイオン生成と輸送を行う事を図ります。

## <自己紹介>

私が真空と出会ったのは、工業系の学校を卒業する際に当時物理の先生より真空製造メーカーを紹介頂いたのがきっかけです。

そして真空製造メーカーに就職をし、製造・搬入・据付をユーザー側の声を基に27年間行って現在に至ります。

現在の会社には7年前に就職し、設計にも携らせて頂いており、今までの経験を活かし新しいイオン注入装置を開発してまいります。